

Katowice, 2 października 2014 r.  
nr sprawy: OS PZ.7222.00073.2014  
nr pisma: OS-PZ.KW-00589/14  
(za dowodem doręczenia)

### DECYZJA Nr 1967/OS/2014

Na podstawie art. 154 § 2 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2013 r. Dz. U. poz.267 ze zm.) i art. 378 ust. 2a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),

#### po rozpatrzeniu

wniosku GT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie o zmianę decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. nr 2131/OS/2008 sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. nr 696/OS/2008 oraz zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2010 r. nr 1208/OS/2010 oraz z dnia 22 kwietnia 2010 r. nr 1447/OS/2010, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC – dwóch automatycznych linii galwanicznych należących do GT Poland Sp. z o.o. w Skoczowie, zlokalizowanych na terenie Oddziału Produkcyjnego w Piersćcu przy ul. Przemysłowej 32,

#### zmieniam

decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. nr 2131/OS/2008 sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. nr 696/OS/2008 oraz zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2010 r. nr 1208/OS/2010 oraz z dnia 22 kwietnia 2010 r. nr 1447/OS/2010, udzielającą GT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC – dwóch automatycznych linii galwanicznych zlokalizowanych na terenie Oddziału Produkcyjnego w Piersćcu przy ul. Przemysłowej 32, w następujący sposób:

I. W części I. „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 1. „Rodzaj prowadzonej działalności”, następująca treść:

„- automatyczna linia galwaniczna nr 2 (projektowana) o pojemności wanień procesowych wynoszącej 48,56 m<sup>3</sup> do pokrywania języków powłoką niklowo-chromową.”

otrzymuje brzmienie:

„- automatyczna linia galwaniczna nr 2 o pojemności wanień procesowych wynoszącej 48,82 m<sup>3</sup> do pokrywania języków powłoką niklowo-chromową.”

**II. W części I. „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 1. „Rodzaj prowadzonej działalności”, następująca treść:**

„Po rozbudowie łączna objętość wani procesowych znajdujących się na terenie zakładu wyniesie 93,56 m<sup>3</sup>.”

Projektowana maksymalna zdolność produkcyjna przedmiotowej instalacji wynosi:

- Linia L1 (modernizowana) dla powłoki chromowo-niklowej lub chromowo-niklowo-miedziowej (zamiennie) – 110 000 m<sup>2</sup>/rok – tj. 17 mln szt. języków/rok.
- Linia L2 (projektowana) dla powłoki chromowo-niklowej 135 000 m<sup>2</sup>/rok – tj. 23 mln szt. języków/rok.”

otrzymuje brzmienie:

„Po rozbudowie łączna objętość wani procesowych znajdujących się na terenie zakładu wyniesie 93,82 m<sup>3</sup>.”

Projektowana maksymalna zdolność produkcyjna przedmiotowej instalacji wynosi:

- Linia L1 dla powłoki chromowo-niklowej lub chromowo-niklowo-miedziowej (zamiennie) – 110 000 m<sup>2</sup>/rok – tj. 17 mln szt. języków/rok.
- Linia L2 dla powłoki chromowo-niklowej 135 000 m<sup>2</sup>/rok – tj. 23 mln szt. języków/rok”

**III. W części I. „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 3. „Opis instalacji i stosowanej technologii”, podpunkt b o treści:**

„b) automatyczna linia galwaniczna nr 2 (L2 projektowana) – do pokrywania powłoką niklowo-chromową. W linii występują następujące procesy:

- odmetalizowanie zawieszek
- nakładanie powłoki niklowej i chromowej

Linia współpracuje z suszarką elektryczną i piecem do odwodorowywania oraz układem wentylacyjnym wraz z urządzeniami ochrony atmosfery.”

otrzymuje brzmienie:

„b) automatyczna linia galwaniczna nr 2 (L2) – do pokrywania powłoką niklowo-chromową. W linii występują następujące procesy:

- odmetalizowanie zawieszek
- nakładanie powłoki niklowej i chromowej

Linia współpracuje z suszarką elektryczną i piecem do odwodorowywania oraz układem wentylacyjnym wraz z urządzeniami ochrony atmosfery.”

**IV. W części I. „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 3. „Opis instalacji i stosowanej technologii”, następująca treść przedostatniego akapitu:**

„Projektowana linia galwaniczna nr 2 będzie pod względem technologicznym zbliżona do linii galwanicznej nr 1. Inny będzie zestaw i kolejność procesów technologicznych. Nie będzie procesów miedziowania i wytrawiania miedzi, wystąpi natomiast proces niklowania satynowego.”

otrzymuje brzmienie:

„Linia galwaniczna nr 2 jest pod względem technologicznym zbliżona do linii galwanicznej nr 1. Inny jest zestaw i kolejność procesów technologicznych. Nie ma

procesów miedziowania i wytrawiania miedzi, wystąpi natomiast proces niklowania mikroporowego (L2/23, L2/24).”

- V. W części I. „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 3. „Opis instalacji i stosowanej technologii”, dodaje się następująca treść:

„Zanieczyszczenia z wanien wchodzących w skład automatycznej linii galwanicznej nr 2, w której prowadzi się procesy: odmetalizowania (1szt.), odtłuszczenia (2szt.), wytrawiania (1szt.), neutralizacji (1szt.), niklowania półmatowego (3szt.), niklowania błyszczącego (3szt.), niklowania mikroporowego (2szt.), aktywacji (2szt.) będą odprowadzane do emitora nr E15 zadaszonego o wysokości 11 m i średnicy 0,8 m. Przed wprowadzeniem do atmosfery opary będą oczyszczane w skruberze S3 o sprawności  $\eta = 80 - 90\%$ .

Jedynie zanieczyszczenia z wanien do chromowania (2 szt.) oraz wanny do uszczelniania (1szt.) wchodzących w skład tej samej automatycznej linii galwanicznej nr 2 odprowadzane będą przez system wentylacji stanowiskowej do emitora nr E16 zadaszonego o wysokości 11 m i średnicy 0,5 m. Przed wprowadzeniem do atmosfery opary będą oczyszczane w wieży adsorpcyjnej S4 o sprawności  $\eta = 80 - 90\%$ .

Linia galwaniczna nr 2 będzie pracować w systemie trójzmiarowym, co daje czas emisji wynoszący ok. 5040 h/rok.”

- VI. W części I. „Rodzaj i parametry instalacji”, w punkcie 4. „Zużycie surowców, paliw i energii”, podpunkt 4.1. „Roczne zużycie surowców w instalacji IPPC (maksymalnie w Mg/rok)” otrzymuje brzmienie:

„4.1. Roczne zużycie surowców w instalacji IPPC

A. ZUŻYCIE SUROWCÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH (ZA WYJĄTKIEM PALIW) NIE ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH:

Kod surowca 5	Surowiec / materiał pomocniczy 6	Zastosowanie 7	Zużycie max [Mg/rok] 8
GMP40431	ANTISCHIUMA 2093A	oczyszczalnia ścieków	1,2
GMP40471	DEMETAL TEL C	usuwanie metalu	2,5
GMP40470	DEMETAL TEL B	usuwanie metalu	1,2
GMP40023	KWAS BOROWY	kąpiel niklu	2,8
GVVBP038	SUPER VELAT SVI6	do suszenia i nadawania połysku wyrobów po chromowaniu	0,8
GMP40202	SACHARYNIAN SODOWY	kąpiel niklu	0,24
GMP40429	WĘGIEL AKTYWNY	oczyszczalnia ścieków	25
GMP40473	CRITERION MP 200 BRIGHT	kąpiel niklu mikroporowy	0,38
GMP40441	CUMAC RIVAL CARRIER	kąpiel miedzi	11,5
GMP40442	CUMAC RIVAL WETTER	kąpiel miedzi	3
GMP40443	CUMAC RIVAL LEVELLER	kąpiel miedzi	3
GMP40402	MIEDŹ METAL	kąpiel miedzi	40
GMP40472	CRITERION MP 200 CARRIER	kąpiel niklu mikroporowy	0,38

GMP40475	CRITERION MP 250 POWDER I	kapiel niklu mikroporowy	0,25
GMP40931	CRYSTAL LEVELER 02	kapiel niklu	0,75
GMP40932	CRYSTAL PURIFIER 84	kapiel niklu	1,5
GMP40455	IDROFLOCK TMT-N	oczyszczalnia ścieków	1,2

**B. ZUŻYCIE SUROWCÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH (ZA WYJĄTKIEM PALIW) ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE**

Kod surowca	Surowiec / materiał pomocniczy	Zastosowanie	Zużycie max [Mg/rok]
2	3	4	5
GMP40930	CRYSTAL SURFACT 47 G	kapiel niklu	1,5
GMP40457	CHROME 200 CATALYST	kapiel chromu katalizator	0,8
GMP40456	TRÓJTLENEK CHROMU	kapiel chromu - uszczelnienie	11
GMP40021	CHLOREK NIKLU	kapiel niklu	1,7
GMP40467	CHROMSTOP AFL	kapiel chromu	0,9
GMP40469	DEMETAL TEL A	usuwanie metalu	2
GMP40445	KWAS AZOTOWY 13%	oczyszczalnia	5
GMP40050	KWAS OCTOWY 60%	usuwanie metalu	1,4
GMP40426	KWAS SIARKOWY 36% cysterna	oczyszczalnia	100
GMP40424	KWAS SIARKOWY 36% kanistry	neutralizacja	12
GMP40056	KWAS SIARKOWY 96% PPA	kapiel niklu	2,1
GMP40428	KWAS SOLNY TECHNICZNY 33%	wytrawianie	32
GMP40460	PICKLANE 31	wytrawianie	2,8
GMP40939	PRESOL 7060	odtłuszczanie elektrolityczne	15
GMP40468	ACTIVE NICHEL 1003	aktywacja	14
GMP40001	NIKIEL METALOWY	kapiel niklu	40
GMP40464	CRYSTAL CARRIER 45 SA	kapiel niklu	2,5
GMP40466	CRYSTAL 301 F BRIGHTENER	kapiel niklu	2
GMP40937	CRITERION SB 100 BRIGHT	kapiel niklu	0,15
GMP40461	CRITERION SB 100 BASE	kapiel niklu	2,2
GMP40430	FLUKOLANT (SCANTEK 55)	oczyszczalnia	0,25
GMP40019	SIARCZAN NIKLU	kapiel niklu	8,6
GMP40452	CHLOREK ŻELAZA	oczyszczalnia	35,8
GMP40436	WĘGLAN BARU	kapiel chromu	0,15
GMP40433	WODOROSIARCZYN SODU 20%	oczyszczalnia	70
GMP40427	WODOROTLENEK SODU 30%	oczyszczalnia	110
GMP40459	PRESOL 1200	odtłuszczanie elektrolityczne	5
GMP40474	CRITERION MP 200 F	kapiel niklu mikroporowy	0,5

GMP40476	CRITERION MP 250 POWDER 2	kapiel niklu mikroporowy	0,25
GMP40929	DECAPANTE PER RAME	chemiczne ściąganie powłoki	0,3
GMP40403	SIARCZAN MIEDZI	kapiel miedzi	8,6
GMP40444	CUMAC RIVAL BRIGHTENER	kapiel miedzi	3
GMP40462	CRITERION SB 100 ADDITIVE	kapiel niklu	1,1
GMP40463	CRITERION SB 100 REPLENISHER	kapiel niklu	4,0
GMP40453	KWAS AMIDOSULFONOWY	oczyszczalnia	0,15
GMP40454	PODCHLORYN SODU	oczyszczalnia	3,0
GMP40451	WAPNO HYDRATYZOWANE	oczyszczalnia	15,0
GMP40940	LUMIA DEOX 412	kapiel miedzi	0,3

”

**VII.** W części III. „Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie i ograniczanie emisji”, w punkcie 1. „Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza”, w podpunkcie 1.1. „Źródła emisji zorganizowanej do powietrza z instalacji IPPC” **litera b) wanny procesowe projektowanej linii galwanicznej nr 2, otrzymuje brzmienie:**

„b) wanny procesowe linii galwanicznej nr 2

Proces	Opis procesu	Nr linii / nr wanny (pojemność wanny)	Łączna pojemność wanień dla procesu m <sup>3</sup>
odmetalizowanie	usuwanie metalu – Ni-Cr z zawieszek	L2/42	2,40
wytrawianie	wytrawianie w roztworze kwasu solnego	L2/6	2,72
odtłuszczenie	odtłuszczenie elektrolityczne	L2/3 L2/9	2,60 2,61
neutralizacja	neutralizacja pozostałości wodorotlenku	L2/12	2,10
nikiel półmatowy	elektrolityczne nakładanie powierzchni	L2/14 L2/15 L2/16	9,42
nikiel błyszczący	elektrolityczne nakładanie powierzchni	L2/17 L2/18 L2/19	9,42
nikiel mikroporowy	elektrolityczne nakładanie powierzchni	L2/23 L2/24	5,05
aktywacja	Dotrawianie elektromechaniczne	L2/21 L2/28	2,20 2,10
<b>RAZEM (m<sup>3</sup>)</b>			<b>40,62</b>

Zanieczyszczenia z nadwanien odciągane są wentylacją mechaniczną i oczyszczane w skruberze wodnym S3 o sprawności 80-90%, a następnie odprowadzane do powietrza emitorem E15 o wysokości h= 11,0 m i średnicy d= 0,80 m.			
Proces	Opis procesu	Nr linii / nr wanny (pojemność wanny)	Łączna pojemność wanien dla procesu m <sup>3</sup>
-	-	-	m <sup>3</sup>
chrom	elektrolityczne nakładanie powierzchni	L2/31 L2/32	6,00
uszczelnienie	elektrolityczne nakładanie powierzchni	L2/36	2,20
<b>RAZEM (m<sup>3</sup>)</b>			<b>8,20</b>
Zanieczyszczenia z nadwanien do chromowania odciągane są systemem wentylacji stanowiskowej i oczyszczane w wieży adsorpcyjnej S4 o sprawności 80-90%, a następnie odprowadzane do powietrza emitorem E16 o wysokości h= 11,0 m i średnicy d = 0,50 m.			

**VIII.**     W części VII. „Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii w instalacji”, następująca treść:

„Zakład posiada „Instrukcję BHP postępowania w razie sytuacji zagrożenia dla pracowników spowodowanej wyciekami substancji niebezpiecznych” i w przypadku wystąpienia zagrożenia zobowiązany jest zgodnie z nią postępować.”

otrzymuje brzmienie:

„Zakład posiada:

- „Instrukcje BHP na stanowiskach pracy, na których występuje zagrożenie dla pracowników spowodowane wyciekami substancji niebezpiecznych”
- „Instrukcję środowiskową zapobiegającą powstawaniu szkodom w środowisku i ich naprawie”
- „Procedurę środowiskową dotyczącą postępowaniu w przypadku zagrożeń środowiskowych”, na potrzeby postępowania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń (wraz z opisem zakresu obowiązków zakładu, dotyczących wystąpienia poważnej awarii).

W przypadku wystąpienia zagrożenia zobowiązany jest postępować zgodnie z tymi instrukcjami”.

**IX.**     Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

**UZASADNIENIE**

Marszałek Województwa Śląskiego decyzją z dnia 5 sierpnia 2008 r. nr 2131/OS/2008 sprostowaną postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2008 r. nr 696/OS/2008 oraz zmienioną decyzjami z dnia 7 kwietnia 2010 r. nr 1208/OS/2010 oraz z dnia 22 kwietnia 2010 r. nr 1447/OS/2010 udzielił GT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC – dwóch automatycznych linii galwanicznych zlokalizowanych na terenie Oddziału Produkcyjnego w Piersćcu przy ul. Przemysłowej 32.

Podaniem z dnia 27 czerwca 2014 r. (wpływ 1 lipca 2014 r.) o znaku GTP/1129/14 uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Urzędu dnia 24 lipca 2014 r. (znak GTP/1308/14), firma GT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie wystąpiła o zmianę ww.

decyzji Marszałka Województwa Śląskiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC – dwóch automatycznych linii galwanicznych zlokalizowanych na terenie Oddziału Produkcyjnego w Pierścicu przy ul. Przemysłowej 32. Zmiany o które wystąpiła strona związane są z planową modernizacją i rozbudową instalacji IPPC poprzez:

- zwiększenie objętości wanień procesowych w galwanizerni z 93,56 m<sup>3</sup> do 93,82 m<sup>3</sup> (o ok.0,3%) w tym: linia L2 z 48,56 m<sup>3</sup> do 48,82 m<sup>3</sup>, poprzez zmianę technologii galwanicznej w linii L2;
- zastąpienie kąpieli niklu satynowego kąpielą niklu mikroporowego (linia nr L2 wanny procesowe nr L23, L24);
- zmiana nazewnictwa i rocznych ilości stosowanych surowców w procesie galwanicznym oraz w oczyszczalni technologicznej.

Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z ust. 2 pkt. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz.1169) a także do § 2 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.). Zatem zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232) Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właściwym do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Przedłożona dokumentacja wymagała złożenia wyjaśnień i uzupełnień (wezwanie z dnia 14 lipca 2014 r. o znaku OS PZ.KW-00432/14).

GT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie przedłożyła uzupełnienia do wniosku pismem z dnia 21 lipca 2014 r. o znaku GTP/1308/14 (wpływ do tut. Urzędu dnia 24 lipca 2014 r.).

Zakład zwrócił się o zmianę decyzji dla instalacji IPPC informując, iż wprowadzane zmiany nie wpłyną na emisję substancji zanieczyszczających do powietrza z linii galwanicznej i z oczyszczalni technologicznej.

Przed wydaniem decyzji umożliwiono stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów – zgodnie z art.10 § 1 Kpa (pismo z dnia 22 września 2014 r.). Strona nie złożyła uwag do zebranego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 155 Kpa, organ administracji publicznej może zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

- zmiana dotyczy decyzji, na mocy której strona nabyła prawo,
- strona wyraziła zgodę na zmianę decyzji,
- przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji
- za zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że Zakład spełnia wszystkie w.w. przesłanki.

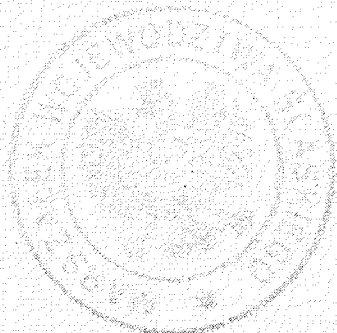
Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzję niniejszą wydano zgodnie z wnioskami strony, przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych.

W związku z powyższym decyzja jest prawnie i merytorycznie uzasadniona.

### Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem organu który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



podpisano:  
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA  
Witold Klimza  
Zast pca Dyrektora  
Wydział Ochrony środowiska